

第1回CECC／CEEIA－JEITA知的財産保護会議の報告

はじめに

当協会と、中国電子商会（China Electronics Chamber of Commerce：CECC）及び中国電器工業協会（China Electrical Equipment Industry Association：CEEIA）は、11月22日、中国・北京で、電子情報産業、電機産業の知的財産保護に関する意見・情報交換のため「第1回CECC/CEEIA-JEITA知的財産保護会議」を開催しました。

中国における模倣品対策等知的財産の適切な保護は、わが国の電子情報産業にとっても大きな課題であり、これまでも官民合同かつ業界横断的組織である国際知的財産保護フォーラムを中心に、様々な取組みがなされてきました（2002年12月と2004年5月の2回にわたって中国にミッションを派遣するなど、JEITAもその中心的なメンバとして活動に貢献）。

今回のCECC/CEEIA-JEITA知的財産保護会議は、国際知的財産保護フォーラムの訪中ミッション以降、日中の電子情報産業が協力してこの問題に取組む最初の具体的な活動であり、双方の業界が模倣品対策に関して、直接意見交換をする初めての会議となりました。

開催概要

日 時：2004年11月22日(月) 9:00～17:40

場 所：北京新世紀飯店

参加者：日本側30名、中国側23名



写真1. 会議場の全景

○日本側参加企業／団体（順不同）

経済産業省商務情報政策局

松下電器産業、沖データ、オリンパス、ケンウッド、三洋電機、シャープ、セイコーエプソン、ソニー、東芝、日本電気、パイオニア、日立製作所、船井電機、三菱電機、アルプス電気、JETRO北京事務所
電池工業会、電子情報技術産業協会（JEITA）

○中国側参加企業／団体（順不同）

中国国家質量監督検査検疫総局

清華同方（Tsinghua Tongfang）、聯想集団（Lenovo Group）、方正科技集団（Founder Group）、中興通迅（ZTE）、河南安彩集団（Ancai Group）、中国普天情報産業集団（China Putian Corp.）、京東方科技集団（BOE Technology）、北京富辰財智（Fortune Consulting）
中国電子商会（CECC）、中国電器工業協会（CEEIA）

議事内容

中国側からは、中国政府代表者による中国政府の知財保護の現状と対策、CECC加盟企業から、企業の知財管理及び権利侵害防止、また、CEEIAからは、知財権意識の強化、模倣打倒、ブランドの保護について、プレゼンテーションが行われました。

これに対し、日本側は、経済産業省から日本における知財問題の現状と対策、JETRO北京知財室より、中国における日本企業の連携による模倣品対策の現状紹介、JEITAからは、日本企業の取組みとして、中国に



写真2. JEITAメンバによるプレゼンテーション

(社)電子情報技術産業協会 知的財産保護専門委員会 委員長
齋藤 憲道
(松下電器産業株式会社 法務本部 理事)

おける模倣品対策、開発段階における他社知財権の侵害を回避するための取組み、知財保護に関する各社の対応状況等を紹介し、JEITA北京事務所の関根所長より、上記3団体に窓口を設置し、日中の業界団体が、①知財保護に係る交流窓口の設置、②両国政府に対する連携した働きかけ、③知財保護に関する情報の交換、④知財保護に関する実態調査、⑤知財保護に係るセミナーの開催、等の知財保護対策について連携をとっていくことを提案しました。

最後に、CECCの王寧副会長が、下記の5点を挙げて会議の成果を総括し、模倣品は日本企業のみでなく中国の企業、消費者にも影響を与えており、問題の解決のためには、日中双方で連携して取組んでいくことが必要で、ぜひ継続して会議を開催していきたいと述べました。

- ・両国業界団体の知財保護の取組みの理解が図れた。
- ・両国政府の知財保護の取組みの理解が図れた。
- ・日本企業の模倣品被害の説明を聞き、中国側に課題が存在することを認識した。今後、日本側との連携の可能性は大いにある。
- ・日本企業の中国における偽造防止に関して、中国側からも提案が行われた。
- ・日本企業の先進的な取組みの紹介は、中国の、特に大手企業にとって非常に参考となった。

所感

JEITAに知的財産保護委員会が設立されて3年になります。初年度はちょうどその時期に発足した国際知的財産保護フォーラムで編成した官民合同訪中代表団の幹事を務め、中国政府に対して知財保護の法令整備や運用面の改善などを求める要請書を作成し、国家工商行政管理総局、国家質量監督検査検疫総局、国家知識産権局、その他関係官庁を訪問して善処を申し入れました。その際、浙江省と広東省政府も訪問しました。

この過程で、当委員会メンバ同士が情報を共有化し、また、経済産業省、特許庁、文化庁、発明協会、JETROなどと連携して作業したことから、知財保護に

関係する人的ネットワークを築き、知識・ノウハウを蓄積できました。これは大きな財産です。

2年目(2003年)は、上記の要請事項について中国の法令、およびその運用面の改善状況の実態調査を行い、継続して要請すべき事項を抽出するとともに、メンバー間で中国ビジネスを中心に情報交換を行いました。

また、新しい試みとして、中国業界団体との知財保護会議開催の可能性を検討しました。JEITAメンバは中国に進出して既に20年近く経っており、一面、中国の現地企業としての顔を持ち合わせています。中国政府に対して外圧をかけるばかりでは不十分です。中国企業の中にも、我々と同様に知的財産を大切にしようとするところがあります。このような状況を考慮し、日中の業界間の交流は意義があるという認識のもとに、CECCに接触を試みました。

そして3年目の2004年、5月の第2回国際知的財産保護フォーラムの訪中ミッションに参加するとともに、11月には1年間準備した前記のCECC/CEEIA-JEITA知的財産保護会議を北京で開催することができました。前者と後者は、一連の取組みと言えます。

当委員会は、会員も徐々に増え、他の工業会やJEITAの他委員会からもオブザーバ参加するようになってきました。現在、模倣品対策などの知財保護を軸に、攻めと守りの両面で活気があります。今後は、経済産業省に2004年に設置された政府模倣品・海賊版対策総合窓口などとも連携しつつ、理論に裏付けられた実践を活発に行っていきたいと考えています。

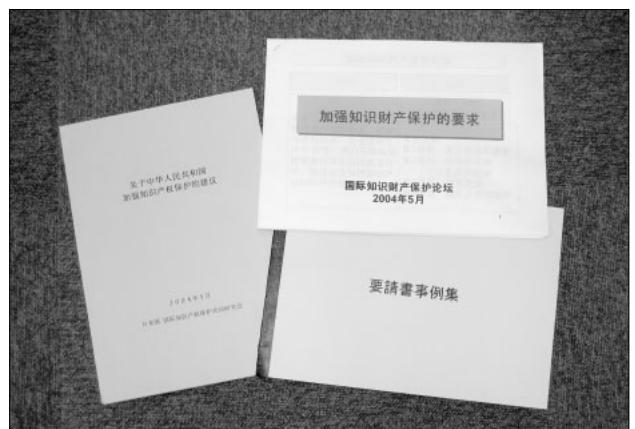


写真3. 国際知的財産保護フォーラム官民合同訪中ミッションで中国側に手交した要請書等資料